

第45期定時株主総会



東京エレクトロン株式会社
2008年6月20日

報告事項

- 第45期の成果報告
- 第46期の業績予想
- 第45期及び第46期の配当
- 事業環境の変化
- 東京エレクトロンの目指すところ

第45期の成果報告

第46期の業績予想

代表取締役社長 佐藤 潔

第45期の成果報告

第45期 連結業績ハイライト

損益計算書

過去最高の売上・利益達成

貸借対照表

財務体質のさらなる改善

キャッシュ・フロー計算書

継続的キャッシュ・フローの創出

第45期 連結業績ハイライト

過去最高の売上・利益達成

売上高 9,060億円、営業利益1,684億円 (18.6%)

財務体質のさらなる改善

自己資本に対する有利子負債の比率が8.7%から6.7%に低下
純資産が前年比 754億円増加

継続的キャッシュの創出

営業キャッシュ・フロー 1,169億円を創出
フリーキャッシュ・フロー 867億円のプラス

連結損益計算書

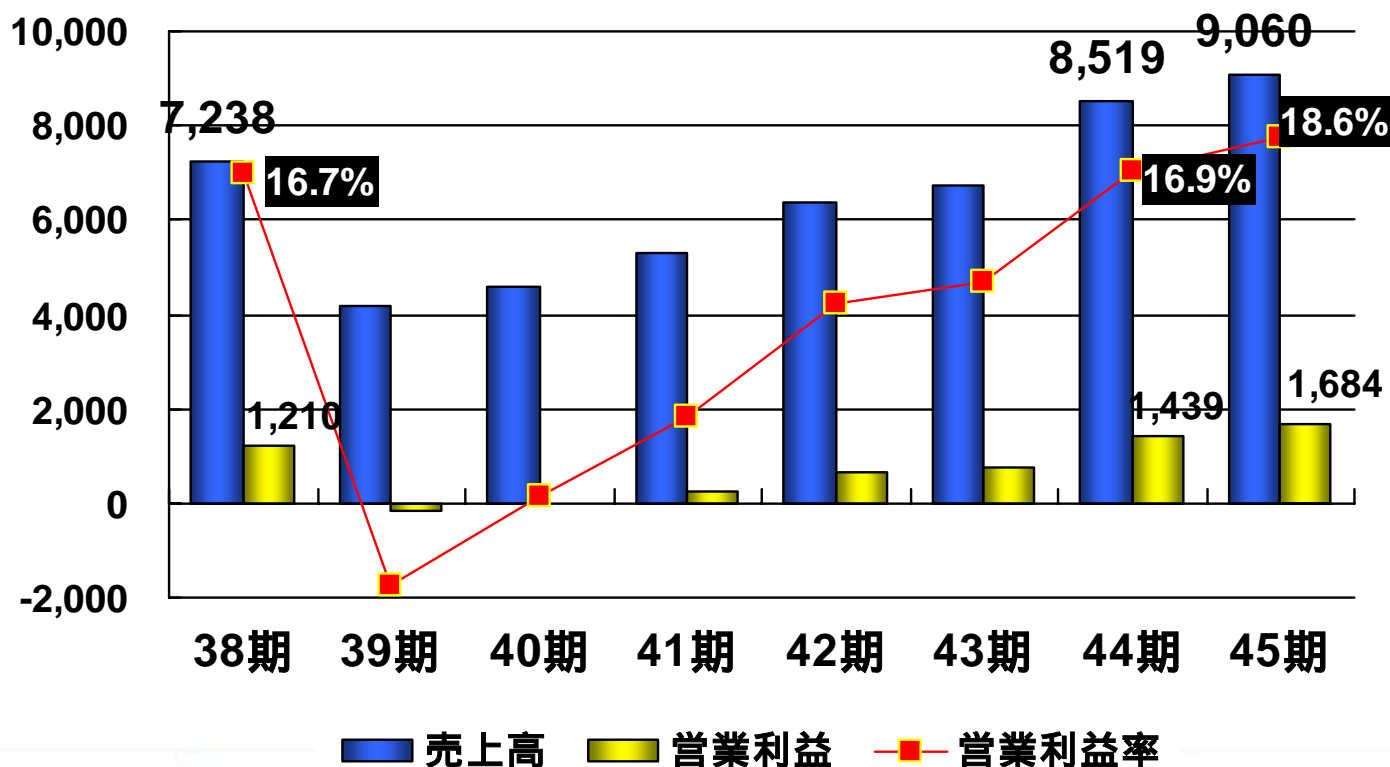
(単位:億円)

	連結				増減率
	第44期 (%)		第45期 (%)		
売上高	8,519	100.0	9,060	100.0	6.4%
営業利益	1,439	16.9	1,684	18.6	17.0%
経常利益	1,439	16.9	1,727	19.1	20.0%
税前利益	1,444	17.0	1,692	18.7	17.2%
当期純利益	912	10.7	1,062	11.7	16.4%

売上、利益ともに過去最高を更新

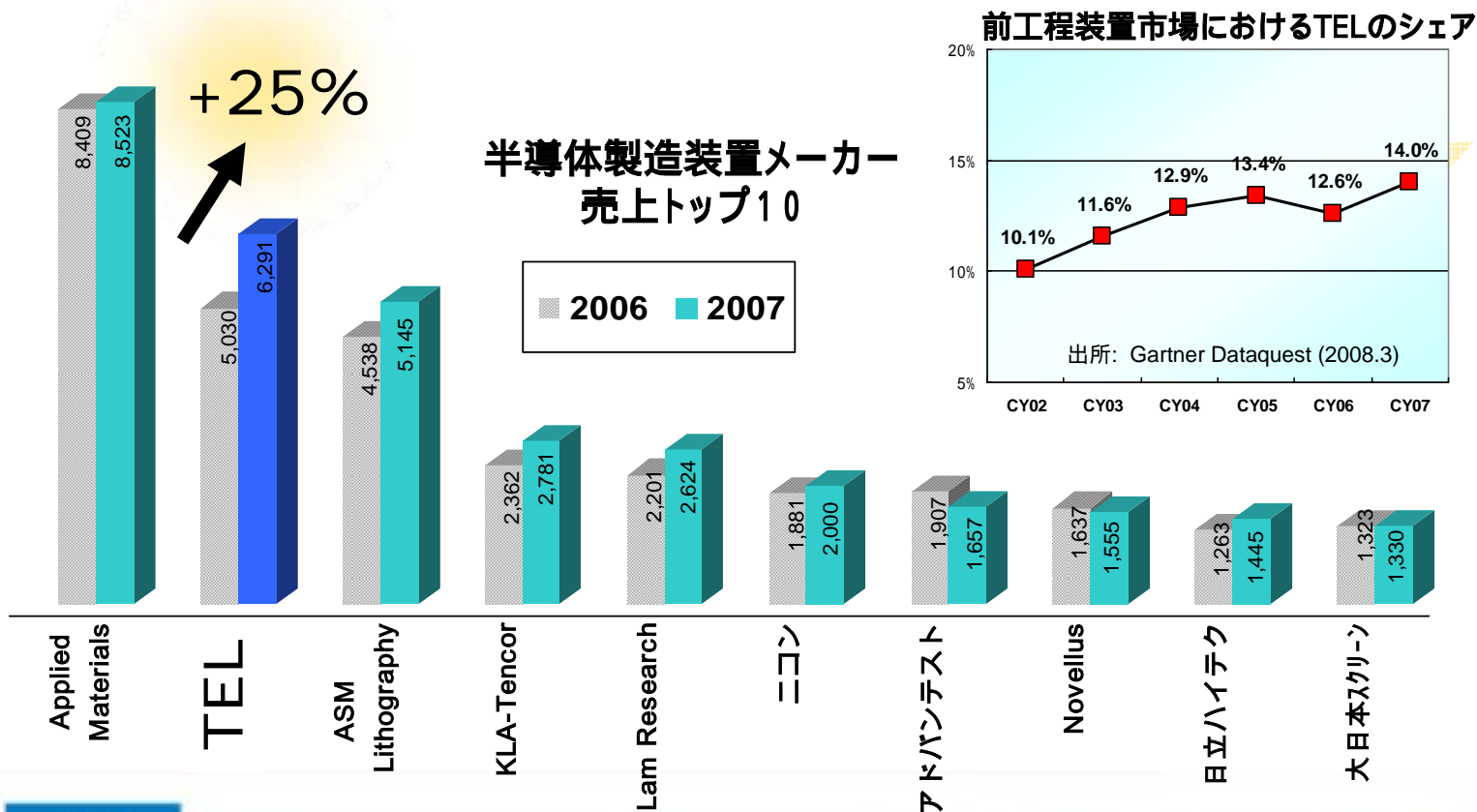
第一目標として設定した「営業利益率17%」の目標を十分に達成

(単位:億円)



市場の平均成長を超えた伸び

2007年の半導体製造装置市場の伸び +7% を超えて成長



Millions of US\$
出所: VLSI Research (2008.3)

平成20年度「知財功労賞」を受賞

知財功労賞：経済産業省特許庁が産業財産権制度を有効に活用し円滑な運営・発展に貢献のあった企業を表彰する



第45期 連結業績ハイライト

過去最高の売上・利益達成

売上高 9,060億円、営業利益1,684億円(18.6%)

財務体質のさらなる改善

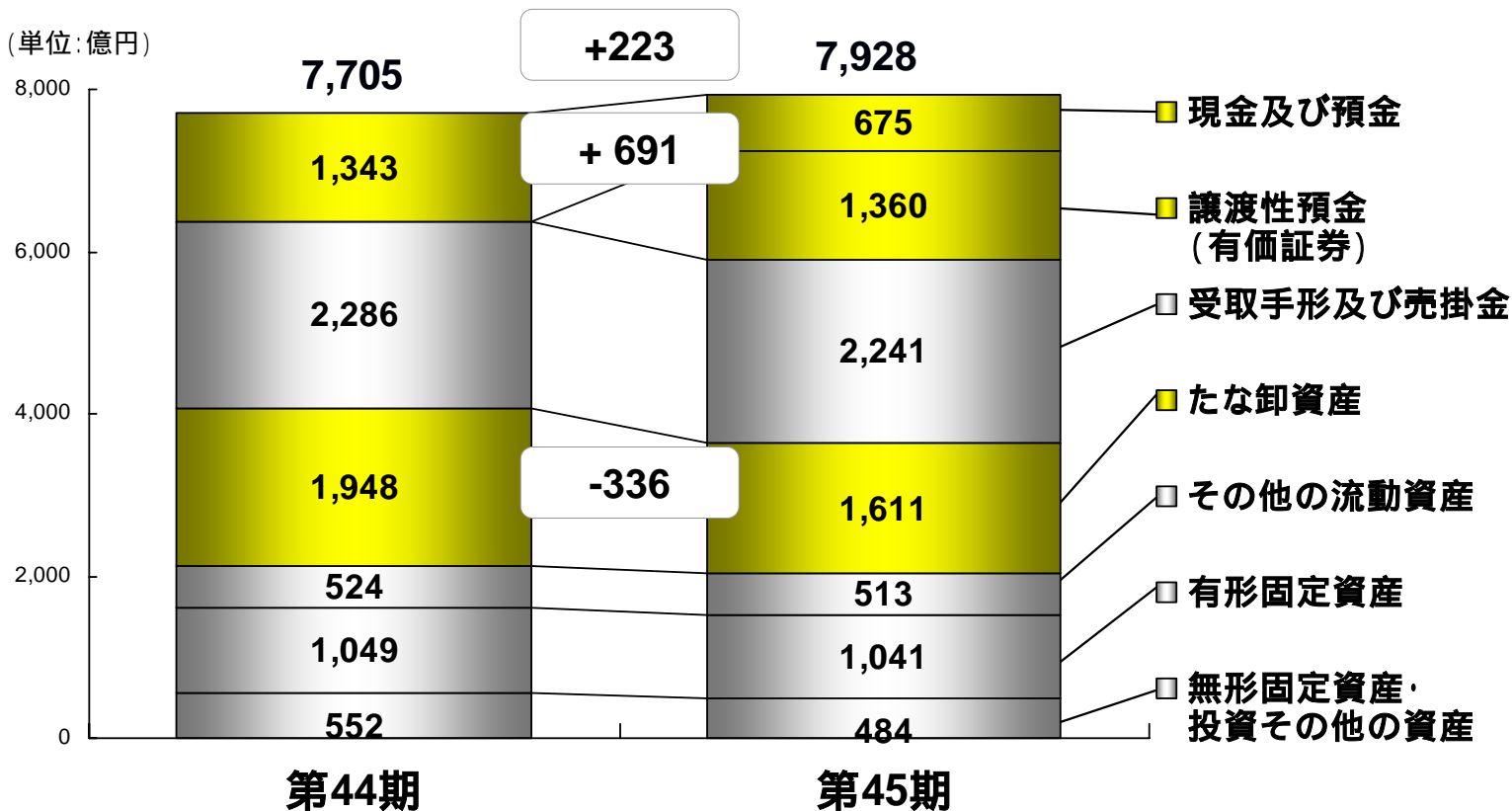
自己資本に対する有利子負債の比率が8.7%から6.7%に低下
純資産が前年比 754億円増加

継続的キャッシュの創出

営業キャッシュ・フロー 1,169億円を創出
フリーキャッシュ・フロー 867億円のプラス

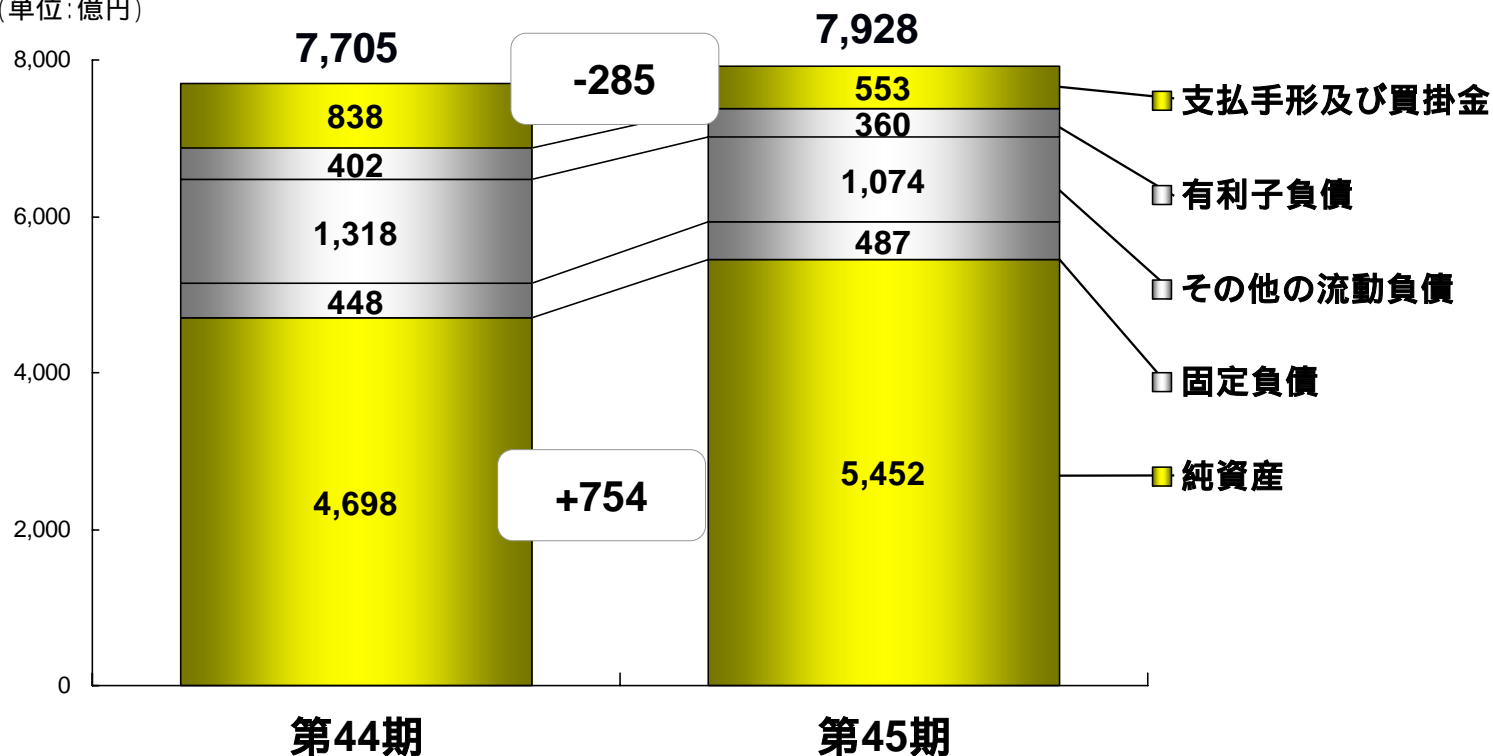
連結貸借対照表 (資産)

(単位: 億円)



連結貸借対照表 (負債・純資産)

(単位: 億円)



自己資本に対する有利子負債の比率が8.7%から6.7%に改善

連結株主資本等変動計算書

(単位:億円)

	株主資本				評価・ 換算 差額等	新株 予約権	少数 株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己 株式				
前期末残高(第44期)	549	783	3,280	121	110	5	90	4,698
当期変動額								
剰余金の配当*1			234					234
当期純利益			1,062					1,062
自己株式の取得				0				0
自己株式の処分		0		8				8
株主資本以外の変動額					89	1	7	82
当期変動額合計	-	0	828	7	89	1	7	754
当期末残高(第45期)	549	783	4,108	113	21	4	98	5,452

*1 取締役会(2007/5/11開催)の決議による期末配当(第44期)、ならびに取締役会(2007/11/13開催)の決議による中間配当(第45期)の合計となります。

第45期 連結業績ハイライト

過去最高の売上・利益達成

売上高 9,060億円、営業利益1,684億円(18.6%)

財務体質のさらなる改善

自己資本に対する有利子負債の比率が8.7%から6.7%に低下
純資産が前年比 754億円増加

継続的キャッシュの創出

営業キャッシュ・フロー 1,169億円を創出
フリーキャッシュ・フロー 867億円のプラス

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)

	第44期	第45期	増減
現金同等物の期首残高	1,400	1,343	56
営業活動によるCF	542	1,169	626
投資活動によるCF	252	301	48
財務活動によるCF	347	270	76
(換算差額)	0	6	6
現金同等物の期末残高	1,343	1,934	591

単独損益計算書・貸借対照表

(単位:億円)

損益計算書	
科目	金額 (%)
売上高	7,675 100.0
営業利益	862 11.2
経常利益	959 12.5
税前利益	857 11.2
当期純利益	514 6.7

貸借対照表			
科目	金額	科目	金額
現預金	515	買掛金	854
受取手形/売掛金	1,943	一年以内償還予定社債	300
有価証券	1,340	その他の流動負債	1,174
たな卸資産	666	固定負債	112
その他の流動資産	666	純資産合計	3,546
有形固定資産	349		
無形固定資産 投資その他の資産	505		
資産合計	5,987	負債・純資産合計	5,987

単独株主資本等変動計算書

(単位:億円)

	資本金	資本 剰余金	利益剰余金				利益剰余金 合計	自己株式 及び 評価・ 換算差額 他	純資産 合計
			利益準備金	その他利益剰余金					
				特別償却 準備金	別途積立金	繰越利益 剰余金			
前期末残高(第44期)	549	783	56	9	1,425	527	2,018	74	3,277
当期変動額									
特別償却準備金の取崩				4		4	-		-
別途積立金の積立*1					300	300	-		-
剰余金の配当*2						234	234		234
当期純利益						514	514		514
自己株式の取得・処分他		0						11	11
当期変動額合計	-	0	-	4	300	14	280	11	268
当期末残高(第45期)	549	783	56	4	1,725	513	2,299	86	3,546

*1 取締役会(2007/5/11開催)の決議によるものです。

*2 取締役会(2007/5/11開催)の決議による期末配当(第44期)、ならびに取締役会(2007/11/13開催)の決議による中間配当(第45期)の合計となります。

新規事業の第45期における進展

新会社設立: 東京エレクトロン技術研究所(株)

高度な技術者集団組織の実現
(RLSA開発部門の独立した開発マネジメント組織)

- 設立: 2007年6月
- 本社: 仙台市泉区
(現 仙台事業所所在地)
- 事業拠点: 仙台、尼崎、山梨(穂坂)
- 資本金: 1億円 (TEL100%出資)



新会社設立の狙い:

- RLSA関連の開発強化と事業化の強力推進
- 大学・研究機関の高い研究水準に対応でき、協力関係を築ける優秀な技術者集団の組織を目指す

RLSA: Radial Line Slot Antenna(低電子温度を特徴とする新プラズマ源)



新会社設立: 東京エレクトロンPV(株)

太陽電池用製造装置事業へ参入

- 設立: 2008年2月
- 本社: 山梨県韮崎市
(現 TELAT(株)所在地)
- 資本金: 5千万円
- 出資比率: 東京エレクトロン51%
シャープ49%



新会社設立の狙い:

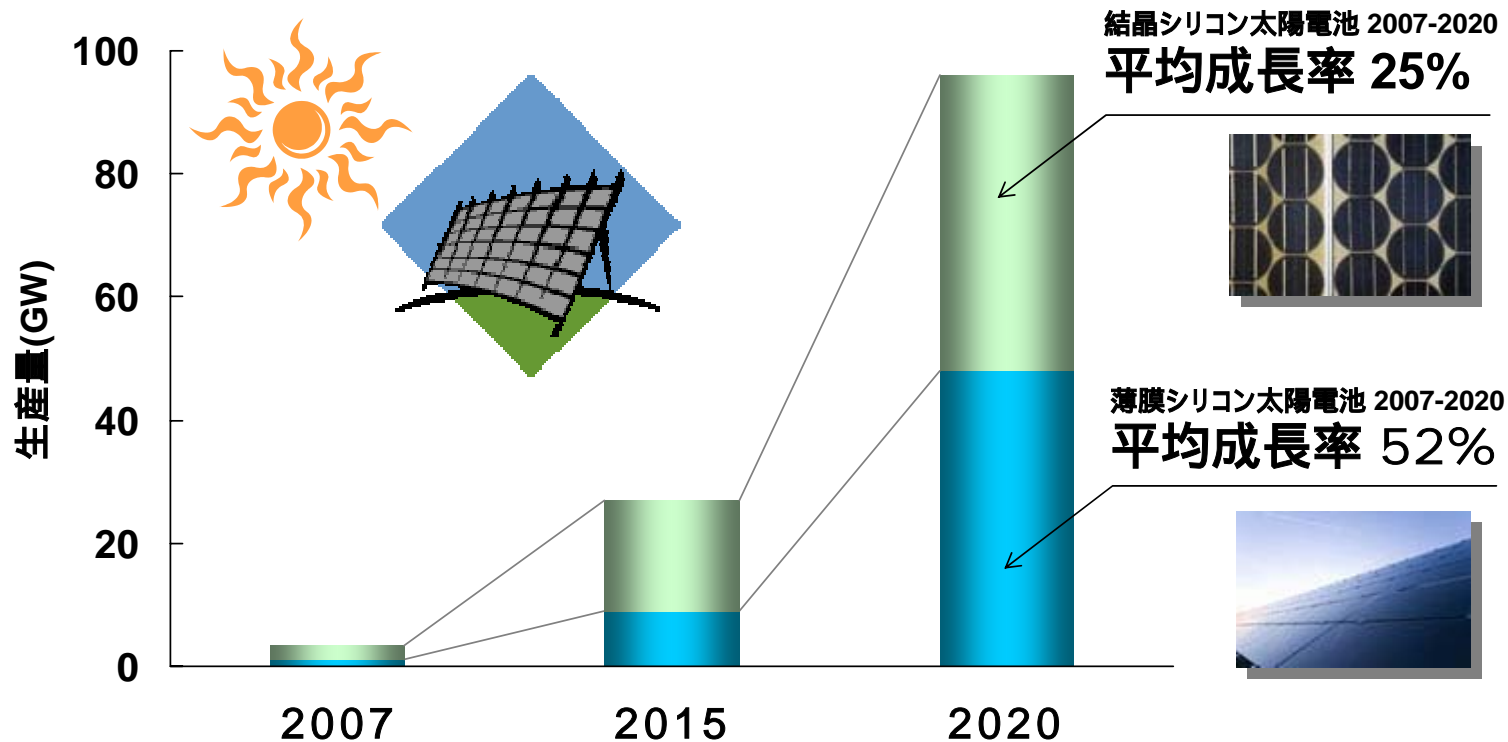
- 東京エレクトロンの真空プラズマ量産装置技術と、シャープの薄膜シリコン太陽電池製造技術を融合
- 生産性の高いプラズマCVD装置の開発



PV: Photovoltaic(太陽電池)、CVD: Chemical Vapor Deposition(化学的気相成長)

高成長が期待される太陽光発電市場

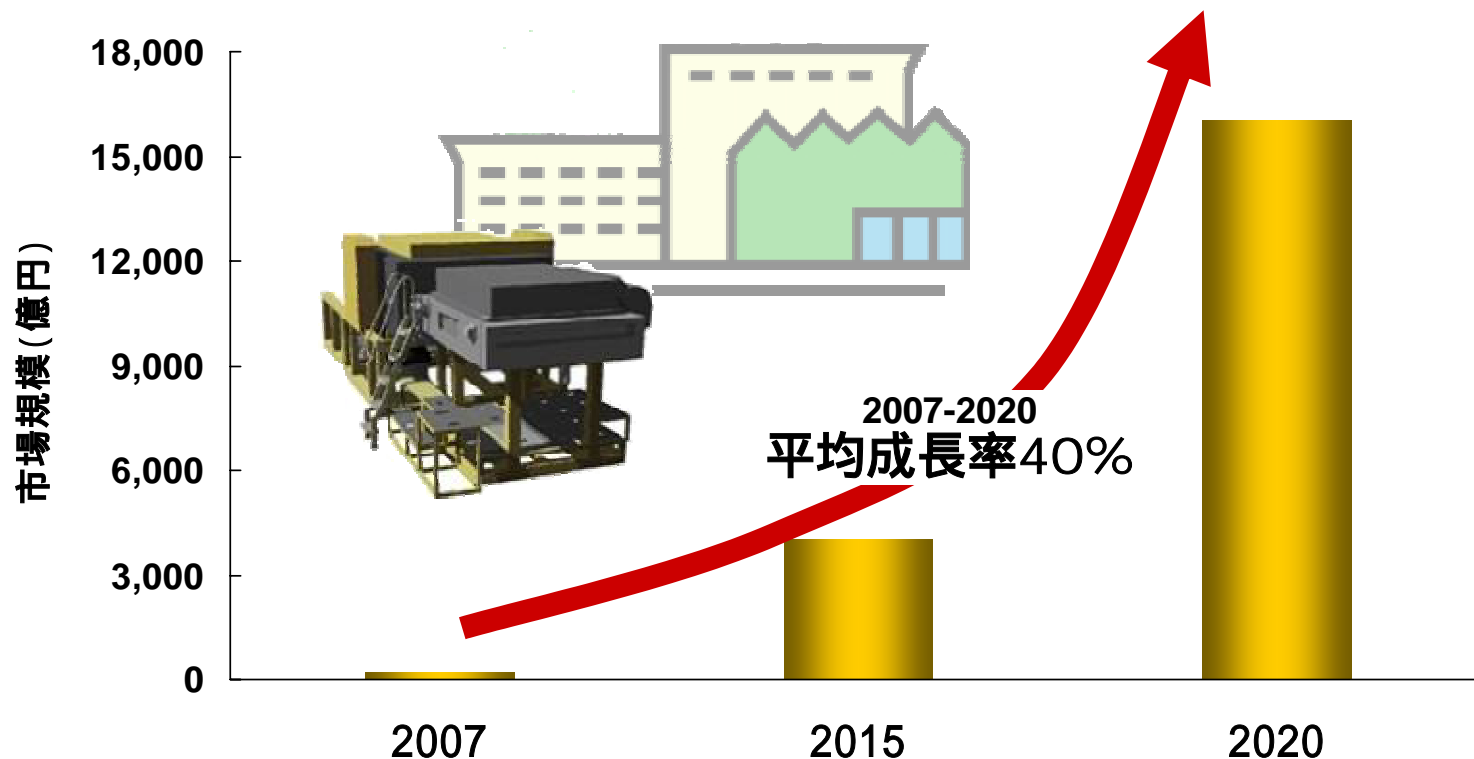
● 太陽電池生産規模



出所：電力需要予測を元にTEL推定

太陽光発電の急拡大を支える装置市場

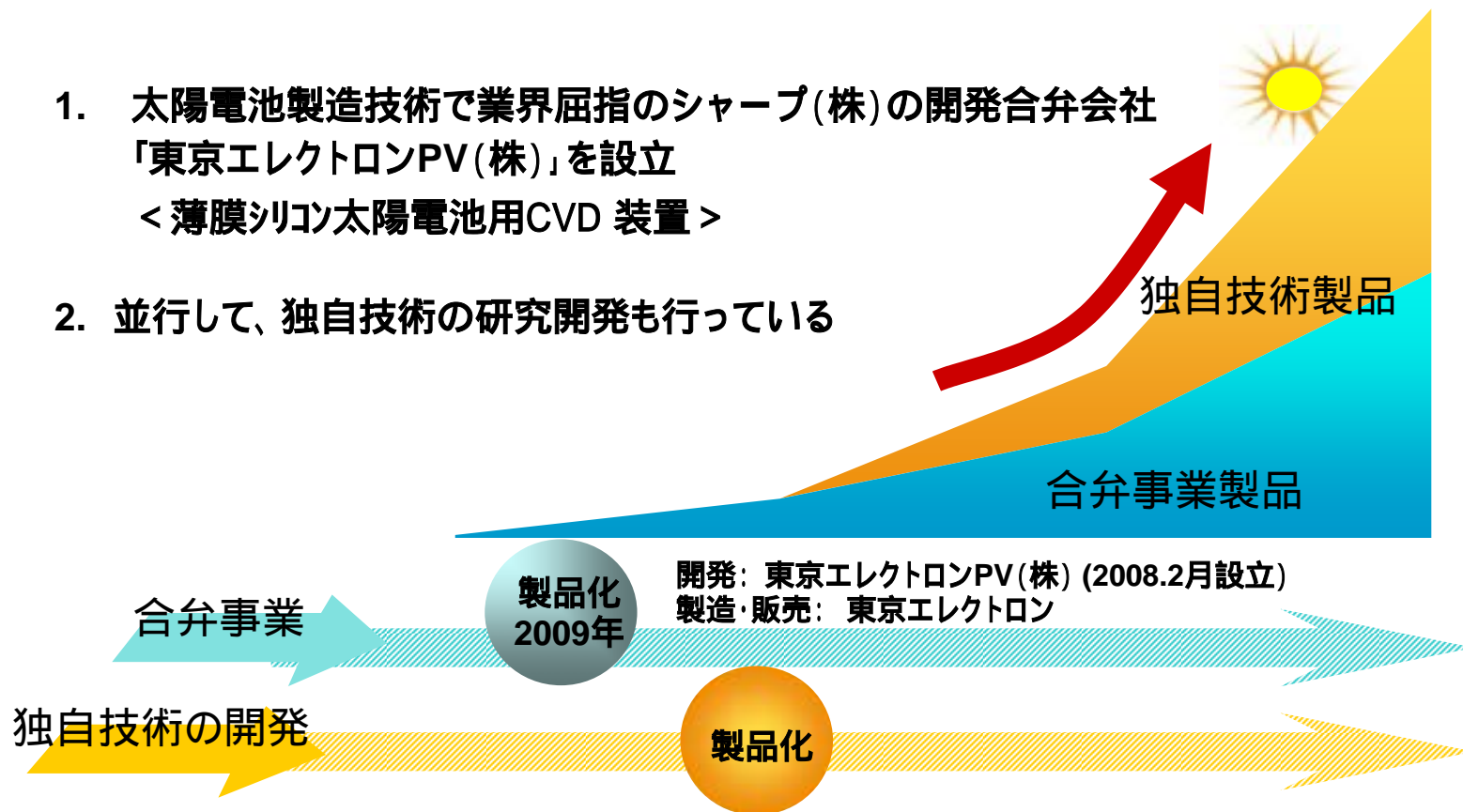
● 薄膜シリコン太陽電池製造装置市場



出所：電力需要予測を基にTEL推定

太陽電池製造装置市場への参入

1. 太陽電池製造技術で業界屈指のシャープ(株)の開発合併会社「東京エレクトロンPV(株)」を設立
 < 薄膜シリコン太陽電池用CVD 装置 >
2. 並行して、独自技術の研究開発も行っている



PV: Photovoltaic (太陽電池)、CVD: Chemical Vapor Deposition (化学的気相成長)



第46期業績予想

第46期業績予想

FPD製造装置事業は1年ぶりに活況となるが、
半導体製造装置事業の減速により、全体として厳しい期となる

(単位:億円)

	第45期		第46期(予想)			
	通期	上期	下期	通期	増減率	
売上高	9,060	3,000	4,000	7,000	-23%	
SPE	7,264	2,080	2,880	4,960	-32%	
FPD	680	380	520	900	+32%	
EC/CN	1,111	535	595	1,130	+2%	
その他	4	5	5	10	+120%	
営業利益	1,684 (18.6)	260 (8.7)	580 (14.5)	840 (12.0)	-50%	
経常利益	1,727 (19.1)	280 (9.3)	600 (15.0)	880 (12.6)	-49%	
税前利益	1,692 (18.7)	280 (9.3)	600 (15.0)	880 (12.6)	-48%	
当期純利益	1,062 (11.7)	170 (5.7)	380 (9.5)	550 (7.9)	-48%	

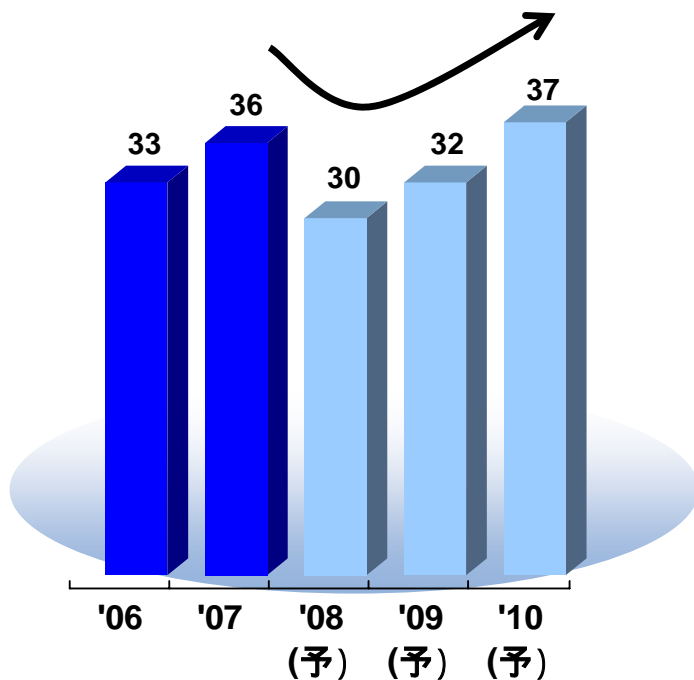
()内は利益率%

SPE: 半導体製造装置, FPD: FPD製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク

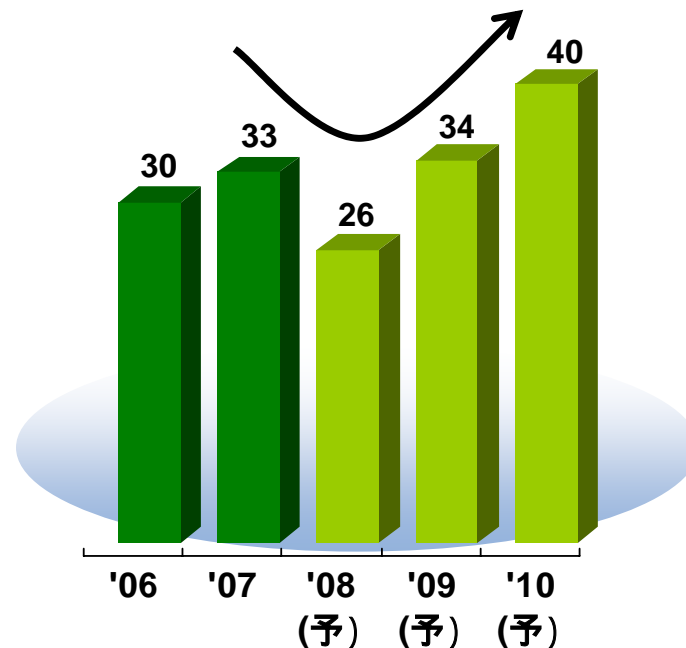


調査機関の半導体前工程装置市場予測

(単位:\$10億)



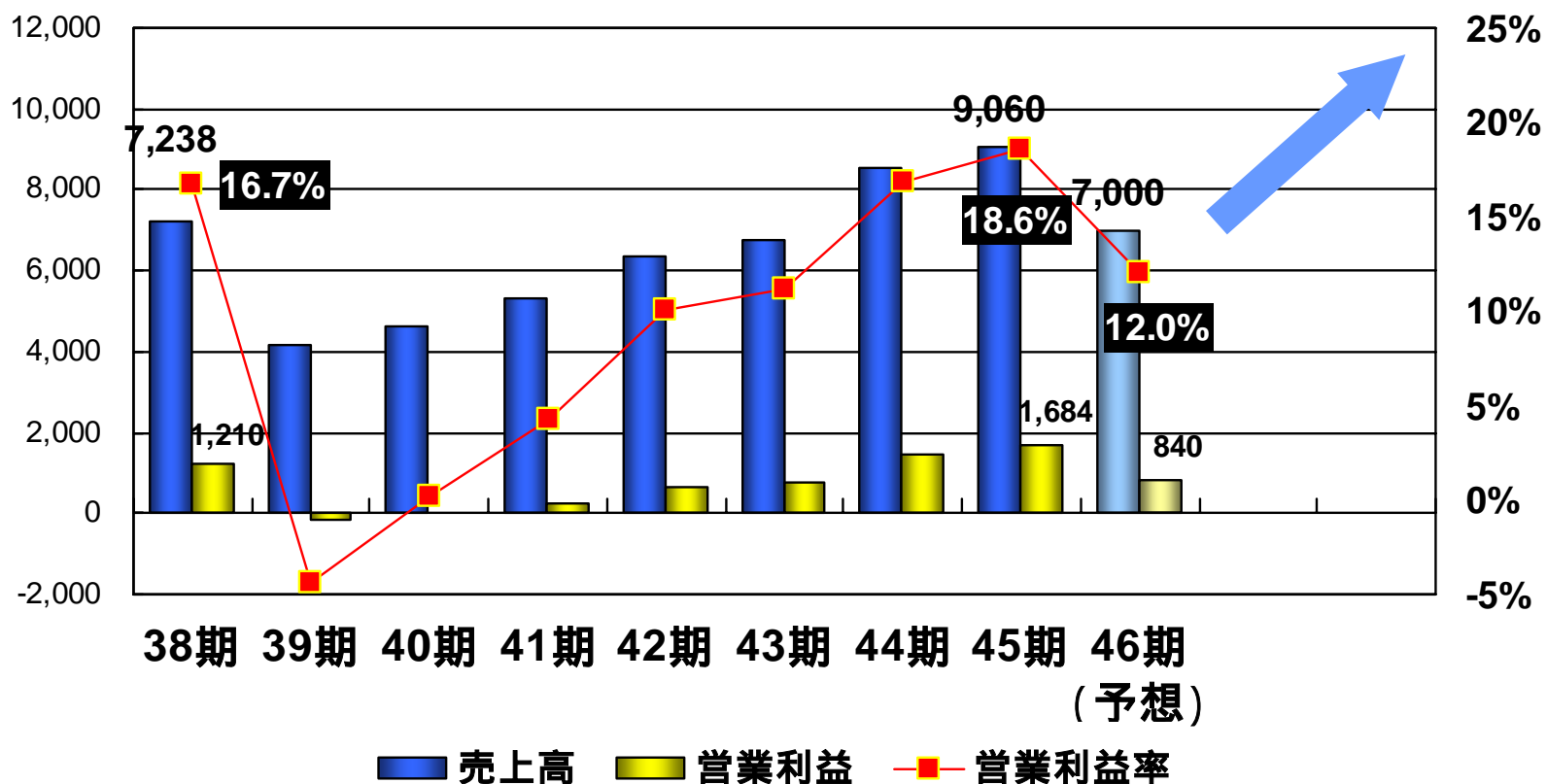
Gartner Dataquest (2008.4)



VLSI Research (2007.12)

売上高・営業利益・営業利益率予想

(単位:億円)



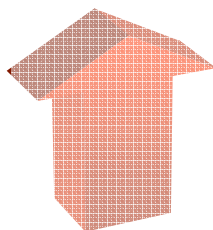
FY: Fiscal Year 3月31日終了の会計年度



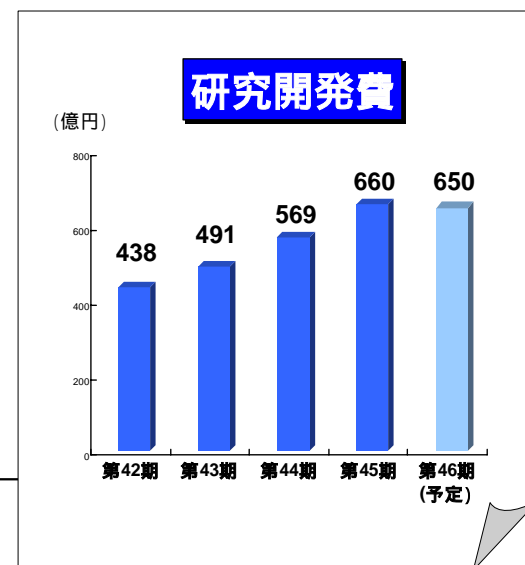
当期の経営方針

第46期は、次の成長期に飛躍するための備えの時期

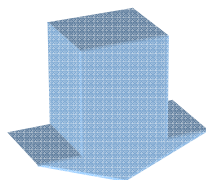
強化



- 研究開発・製品開発
 - 半導体技術革新
(微細化・新材料・3Di, etc)
 - 新規事業分野
- モノづくり
 - 製造リードタイム短縮
 - 宮城新工場に向けた準備
- ポストセールス事業



見直し/縮小



- 経費の大幅削減
 - 海外拠点を含めた人員配置の見直し
 - 外注コストの低減, etc.



**私たちの技術が
世界を支え、未来を創ります。**



第45期及び第46期の配当

事業環境の変化

東京エレクトロンの目指すところ

代表取締役会長 東 哲郎

第45期及び第46期の配当

連結損益計算書

(単位:億円)

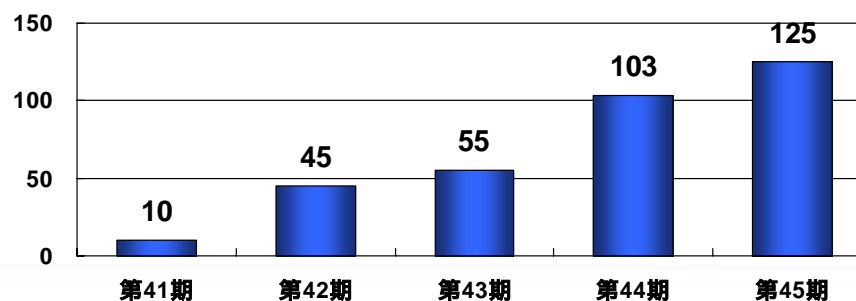
	連結				増減率
	第44期 (%)		第45期 (%)		
売上高	8,519	100.0	9,060	100.0	6.4%
営業利益	1,439	16.9	1,684	18.6	17.0%
経常利益	1,439	16.9	1,727	19.1	20.0%
税前利益	1,444	17.0	1,692	18.7	17.2%
当期純利益	912	10.7	1,062	11.7	16.4%

剰余金の配当

1株当たり配当金

	中間	期末	年間	配当総額	連結 配当性向
第45期	70 円	55 円	125 円	223 億円	21.0 %
第44期 (ご参考)	42 円	61 円	103 円	184 億円	20.1 %

(円) 過去5年間の配当金推移



第46期配当予想

(単位:億円)

	連結				
	第45期 (%)		第46期予想 (%)		増減率
売上高	9,060	100.0	7,000	100.0	-23%
営業利益	1,684	18.6	840	12.0	-50%
当期純利益	1,062	11.7	550	7.9	-48%

- 業績連動型・収益対応型の配当を継続的に行うことを株主還元の基本方針とし、第43期より、連結当期純利益に対し20%を目処に配当を実施しております。

	中間	期末	年間
1株当り配当予想	19 円	43 円	62 円

(予定)



今後の株主還元について

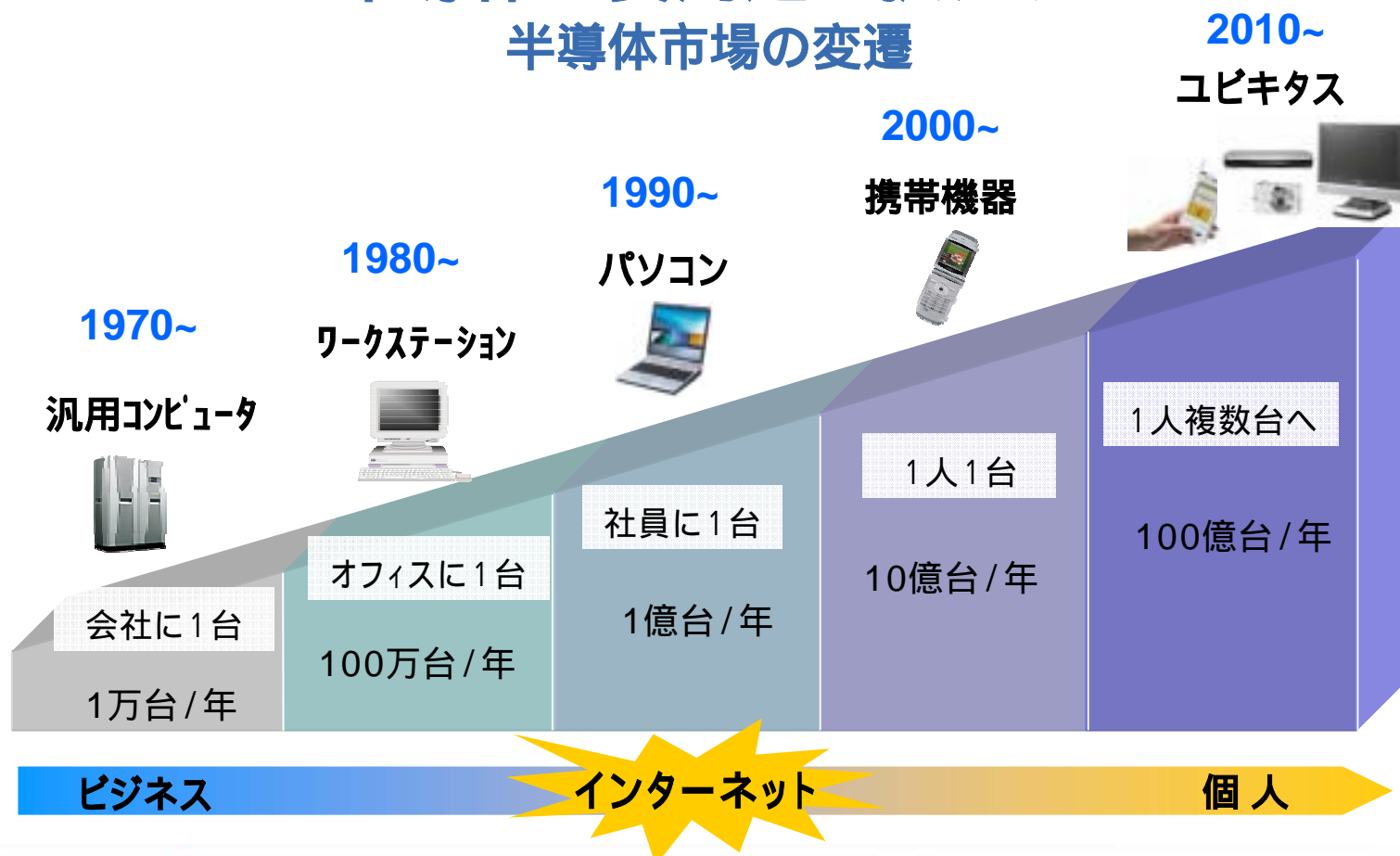
- 事業の成長・利益の拡大
- 資本政策
- 配当政策・自社株買い

上記を総合的に検討して参ります。

事業環境の変化

半導体主要用途の拡がり

半導体市場の変遷



* ユビキタス: インターネットなどの情報ネットワークに「いつでもどこからでも」アクセスできる環境。



より健全で質の高い生活の実現



環境問題の解決



東京エレクトロンの目指すところ

さらなる成長へ向けて

過去最高の売上・利益を達成
営業利益率18.6%を達成

営業利益率 10%回復

新成長戦略

第二次中期経営計画期

●営業利益率
23%を目標とする

●新規事業の開拓

構造改革期

- 固定費の削減
- 在庫の適正化

第一次中期経営計画期

- 新製品創出の強化
- モノづくりの強化
- 経営効率の改善

第39期～第41期

第42期～第45期

第46期～

～2020



技術で環境問題に取り組む

企業の責任、使命、そして大きなビジネスチャンス



● TEL装置の省エネルギー化を促進

- 省電力・省薬液などで
- TEL装置の排出する二酸化炭素を削減

● 省電力・高効率デバイスを作る製造装置の提供

- RLSAプラズマ装置
- パワー半導体用SiCエピ膜成長装置
- 有機EL製造装置

● クリーンエネルギー関連の製造装置の提供

- 太陽電池製造装置

RLSA: Radial Line Slot Antenna (低電子温度を特徴とする新プラズマ源)

SiC: Silicon Carbide (炭化珪素)

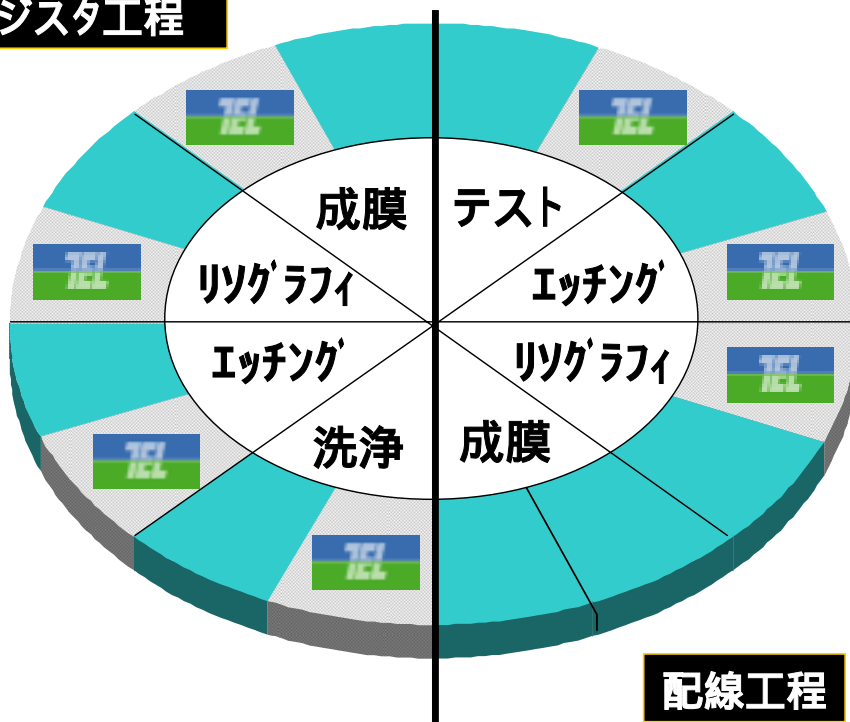


半導體製造裝置事業

マーケットシェアの引き上げ

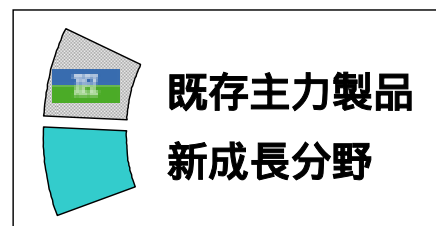
半導体製造プロセス

トランジスタ工程

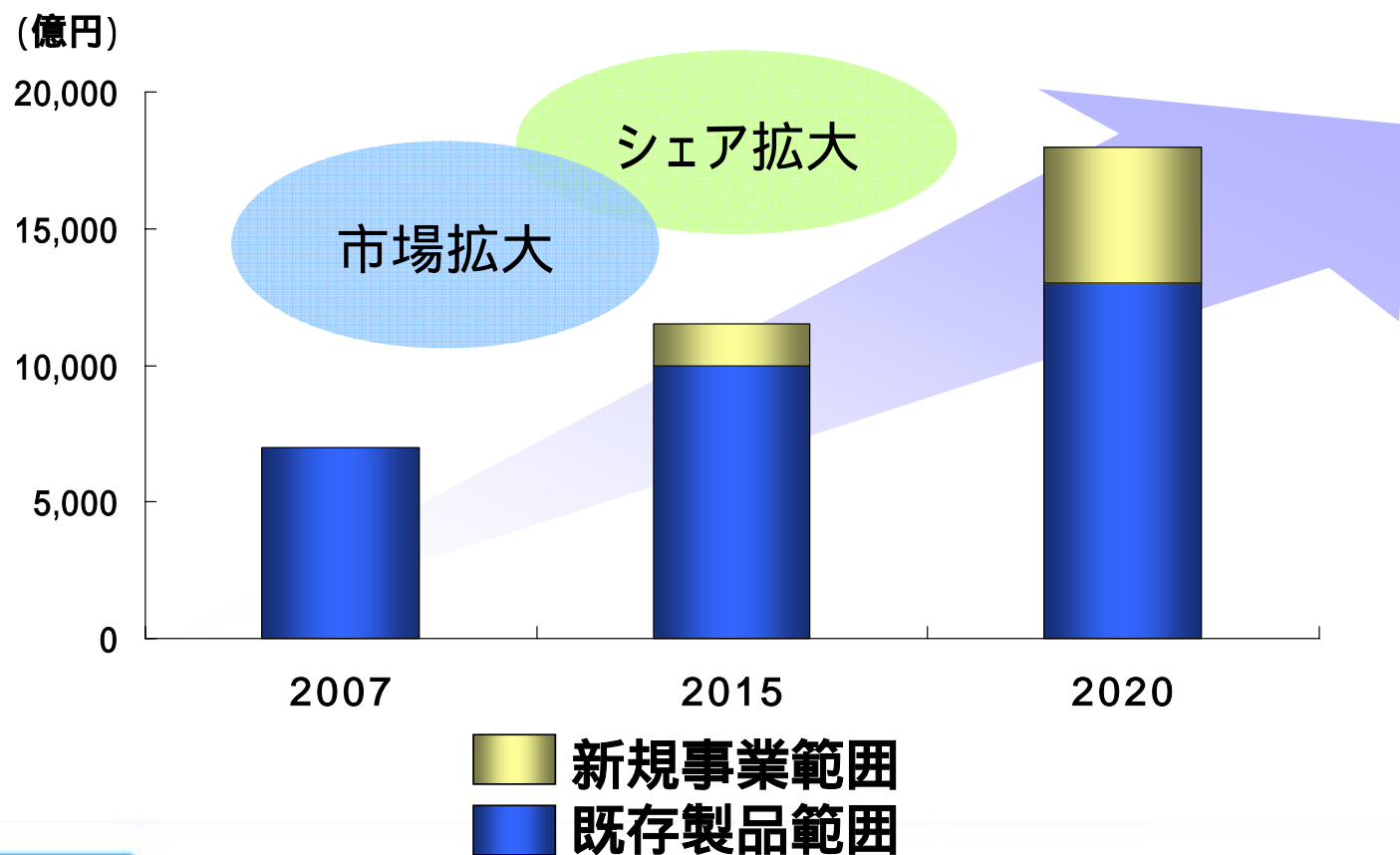


配線工程

- 既存製品の強化
- 新成長分野への取り組み
(差別化技術/M&A)
- プロセス統合で技術革新を先導する



2020年 半導体製造装置事業の構成



FPD製造装置事業

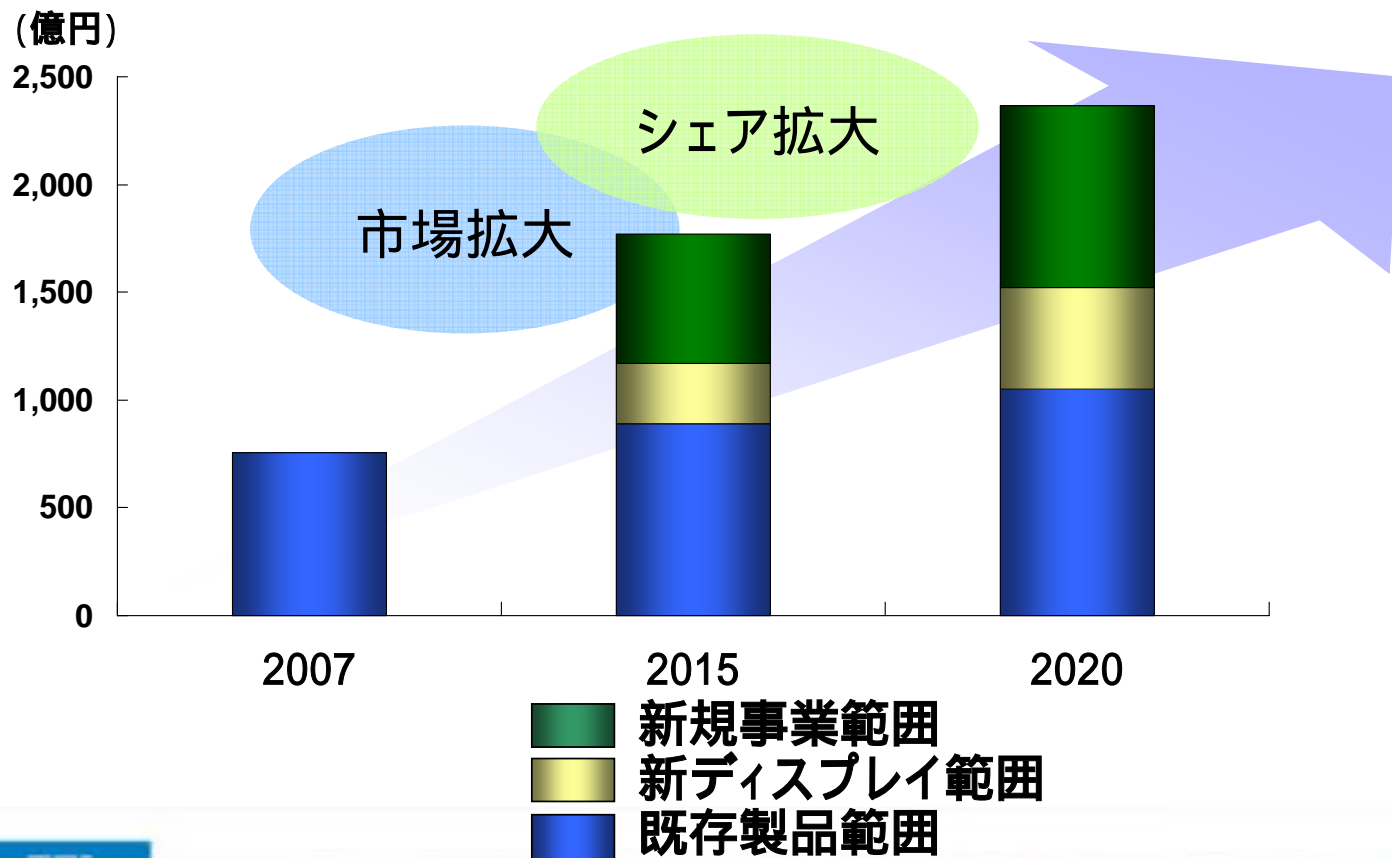
FPDが生み出す ビジュアルワールド

応用機器の拡大、新ディスプレイの登場が拓げる世界



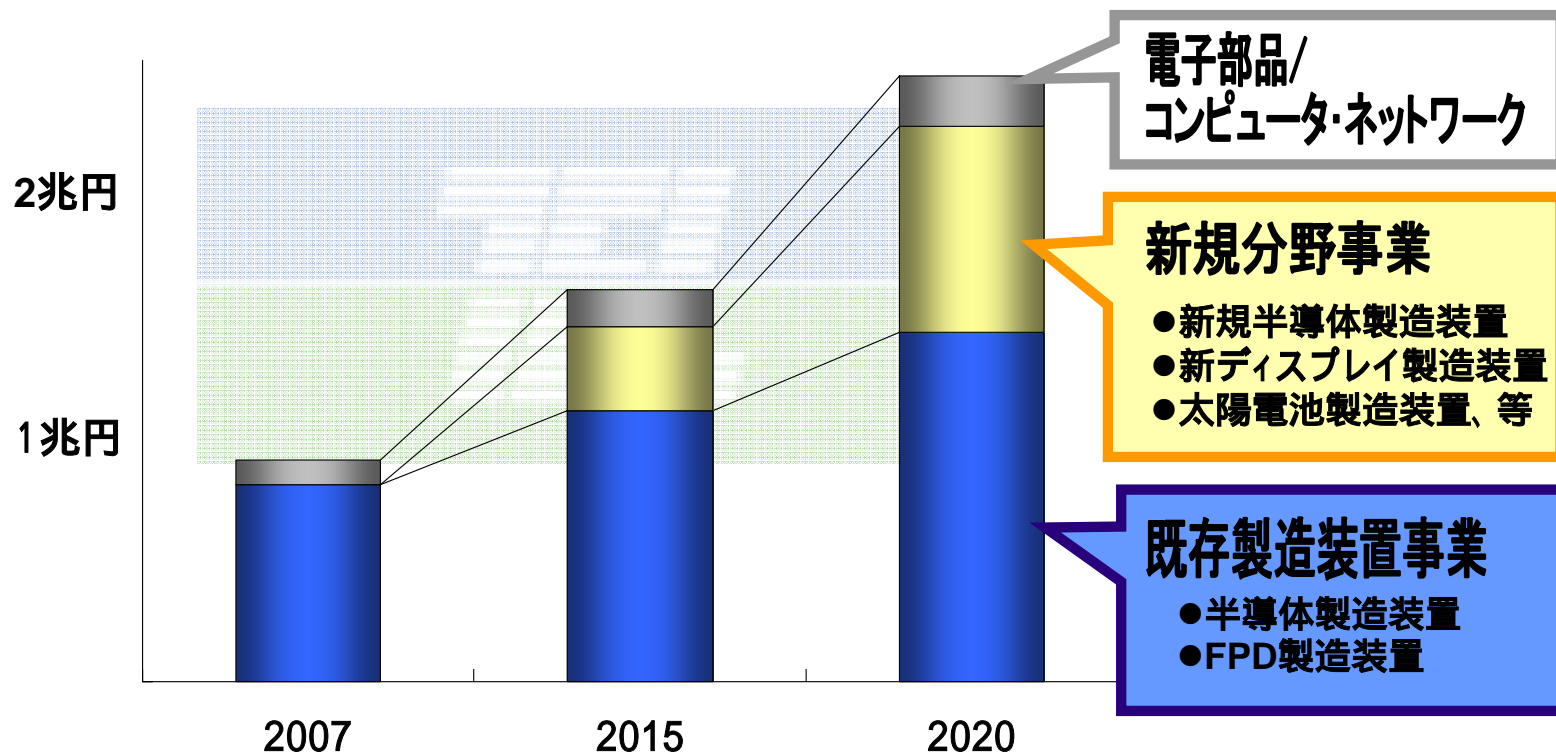
2020年 FPD製造装置事業の構成

事業領域を拡げ、売上規模拡大を狙う



2020年までの成長に向けて

2020年 売上高2兆円へのロードマップ



TEL ビジョンと中・長期目標

TELビジョン

人々のより健全で質の高い生活を実現するために、
先端分野に於けるトップサプライヤーとして
価値の高い技術・サービスを世界に提供する

中長期ビジョン

2020年：売上2兆円

事業構成

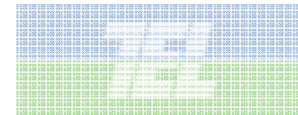
半導体事業、FPD事業を主軸
とし、新規技術分野・装置周辺
事業の拡大、環境関連事業な
ど新分野への参入を図る



FPD:フラットパネルディスプレイ

新たな成長に向けて

「強力な成長戦略を基盤に
今後も企業価値向上に邁進し、
株主の皆様をはじめとする
世界中のステークホルダーの
ご満足を達成していきたい
と考えています」





**私たちの技術が
世界を支え、未来を創ります。**



< 決議事項 >

- 1 . 取締役 1 4 名選任の件
- 2 . 監査役 2 名選任の件
- 3 . 第 4 5 期取締役賞与金支給の件
- 4 . 当社取締役に対し株式報酬として
新株予約権（ストックオプション）を発行する件
- 5 . 当社及び当社子会社の役員等に対し
株式報酬として新株予約権（ストックオプション）を
発行する件

第1号議案

取締役14名選任の件

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)		所有する 当社の株式数
1	東 哲郎 (S24.8.28生)	昭和52年 4月 平成 2年12月 平成 6年 4月 平成 8年 6月 平成15年 6月	当社入社 当社取締役 当社常務取締役 当社取締役社長 当社取締役会長 (現在に至る)	29,028株
		(当社における地位及び担当) 代表取締役会長 (他の法人等の代表状況) Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. 取締役会長 (社)日本半導体製造装置協会会長		

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
2	常石 哲男 (S27.11.24生)	<p>昭和51年 4月 当社入社 平成 4年 6月 当社取締役 平成 8年 6月 当社専務取締役 平成15年 6月 当社取締役副会長 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 取締役副会長 IR、法務・知的財産、 カスタマーリレーション担当</p> <p>(他の法人等の代表状況) Tokyo Electron (Shanghai) Ltd. 取締役会長 Tokyo Electron (Shanghai) Logistic Center Ltd. 取締役会長</p>	3,658株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
3	佐藤 潔 (S31.4.2生)	<p>昭和54年 4月 当社入社</p> <p>平成13年12月 当社クリーントラックBUGM</p> <p>平成15年 4月 当社社長付執行役員</p> <p>平成15年 6月 当社取締役社長 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 代表取締役社長</p> <p>(他の法人等の代表状況)</p> <p>Tokyo Electron America, Inc.取締役CEO</p> <p>Timbre Technologies, Inc.取締役会長</p> <p>TEL Venture Capital, Inc.取締役会長</p> <p>Tokyo Electron Europe Ltd.取締役会長</p> <p>Tokyo Electron Korea Solution Ltd. 取締役会長</p>	2,000株



BUGM = ビジネスユニットジェネラルマネージャー

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
4	岩津 春生 (S25.3.20生)	昭和59年11月 当社入社 平成5年4月 東京エレクトロ九州(株)取締役 平成10年4月 同社常務取締役 平成12年1月 当社洗淨システムBUGM 平成15年4月 東京エレクトロ九州(株)取締役社長 平成17年6月 当社取締役 平成18年10月 東京エレクトロ九州(株)取締役会長 (現在に至る) 平成19年6月 当社取締役副社長 (現在に至る) (当社における地位及び担当) 取締役副社長	3,000株



BUGM = ビジネスユニットジェネラルマネージャー

第1号議案

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)		所有する 当社の株式数
5	原 護 (S21.8.14生)	昭和45年 4月	当社入社	6,000株
		平成元年12月	当社取締役	
		平成 8年 4月	東京エレクトロン東北(株) 専務取締役	
		平成 8年 6月	当社取締役退任	
		平成11年 3月	東京エレクトロンEE(株) 取締役社長	
		平成13年 7月	東京エレクトロンデバイス(株) 取締役会長	
		平成14年 2月	東京エレクトロンAT(株) 取締役社長	
		平成14年 6月	当社取締役 (現在に至る)	
		(当社における地位及び担当) 取締役		

第1号議案

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
6	久保寺 正男 (S24.6.21生)	<p>昭和54年 1月 当社入社</p> <p>平成 6年 4月 テル・エンジニアリング(株)取締役</p> <p>平成 7年 7月 東京エレクトロン山梨(株) 常務取締役</p> <p>平成10年 4月 東京エレクトロン宮城(株) 取締役社長</p> <p>平成13年 4月 東京エレクトロンAT(株) 専務取締役</p> <p>平成15年 4月 同社取締役会長</p> <p>平成16年 6月 当社取締役 (現在に至る)</p> <p>平成19年 6月 東京エレクトロンAT(株) 取締役会長 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 取締役 技術・開発担当</p>	2,552株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)		所有する 当社の株式数
7	本田 祐一 (S22.8.22生)	昭和61年 7月 平成 6年 6月 平成10年 4月 平成10年 6月 平成14年 3月 平成17年 6月	当社入社 当社取締役 当社コーポレート・シニア・ スタッフ 当社取締役退任 Tokyo Electron Europe Ltd. 取締役 当社取締役 (現在に至る)	5,100株
		(当社における地位及び担当) 取締役 財務・経理担当		

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
8	北山 博文 (S29.3.28生)	<p>昭和58年12月 テル・サームコ(株)入社</p> <p>平成7年7月 東京エレクトロン東北(株)取締役</p> <p>平成11年3月 東京エレクトロン山梨(株)取締役</p> <p>平成15年4月 東京エレクトロンAT(株)常務執行役員</p> <p>平成17年2月 同社取締役社長</p> <p>平成18年4月 東京エレクトロン東北(株)取締役社長 (現在に至る)</p> <p>当社執行役員、SPE-3事業部長 (現在に至る)</p> <p>平成19年6月 当社取締役、常務執行役員 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 取締役 常務執行役員</p> <p>(他の法人等の代表状況) 東京エレクトロン東北(株)取締役社長</p>	1,000株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
9	竹中 博司 (S36.2.5生)	<p>昭和59年 4月 当社入社</p> <p>平成13年12月 当社枚葉成膜部長</p> <p>平成14年 4月 当社枚葉成膜BUGM</p> <p>平成15年 4月 当社執行役員</p> <p>平成17年 4月 当社サーマルプロセスシステムBUGM (現在に至る)</p> <p>平成18年 4月 当社SPE-3事業部 副事業部長 (現在に至る)</p> <p>平成19年 6月 当社取締役、常務執行役員 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 取締役 常務執行役員</p>	1,200株



BUGM = ビジネスユニットジェネラルマネージャー

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
10	鷲野 憲治 (S36.6.7生)	<p>昭和59年 4月 当社入社</p> <p>平成14年10月 当社洗淨システム部長</p> <p>平成15年 4月 当社執行役員、 洗淨システムBUGM</p> <p>平成17年 4月 当社枚葉成膜BUGM (現在に至る)</p> <p>平成18年 4月 当社SPE-2事業部 副事業部長 (現在に至る)</p> <p>平成19年 6月 当社取締役、常務執行役員 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 取締役 常務執行役員</p>	2,000株

BUGM = ビジネスユニットジェネラルマネージャー



候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
11	伊東 晃 (S36.8.30生)	<p>昭和59年 4月 当社入社</p> <p>平成13年 6月 Tokyo Electron America, Inc.クリーントラックBUMネージャー</p> <p>平成15年 4月 当社執行役員、 クリーントラックBUGM</p> <p>平成18年 4月 当社SPE-1事業部 副事業部長</p> <p>平成19年 6月 当社取締役、常務執行役員、 SPE-2事業部 副事業部長、 エッチングシステムBUGM (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 取締役 常務執行役員</p>	2,100株

BU = ビジネスユニット

BUGM = ビジネスユニットジェネラルマネージャー



候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
12	井上 弘 (S15.1.5生)	<p>昭和38年 4月 (株)東京放送入社</p> <p>平成 5年 6月 同社取締役</p> <p>平成 8年 6月 同社常務取締役</p> <p>平成 9年 6月 同社専務取締役</p> <p>平成13年 6月 同社取締役副社長</p> <p>平成14年 6月 同社取締役社長 (現在に至る)</p> <p>平成18年 6月 当社取締役 (現在に至る)</p> <p>(当社における地位及び担当) 取締役</p> <p>(他の法人等の代表状況) (株)東京放送取締役社長 (株)TBSテレビ取締役社長</p>	0株

■ 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります



候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
13	常深 康裕 (S24.1.21生)	昭和48年 4月 (株)日立製作所入社 平成10年 2月 (株)日立総合計画研究所 (出向) 主管研究員 平成18年 2月 (株)日立製作所退社 平成18年 6月 当社取締役 (現在に至る) (当社における地位及び担当) 取締役	0株

- 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
14	坂根 正弘 (S16.1.7生)	昭和38年 4月 (株)小松製作所入社 平成元年 6月 同社取締役 平成 6年 6月 同社常務取締役 平成 9年 6月 同社専務取締役 平成11年 6月 同社取締役副社長 平成13年 6月 同社取締役社長 平成15年 6月 同社取締役社長兼CEO 平成19年 6月 同社取締役会長 (現在に至る)	0株

- 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります

第2号議案

監査役2名選任の件

氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)		所有する 当社の株式数
田中 健生 (S21.1.23生)	昭和47年10月 平成 3年10月 平成 6年 4月 平成 6年10月 平成 8年 6月 平成14年 2月 平成14年 2月 平成16年 6月 (当社における地位及び担当) 常勤監査役	当社入社 東京エレクトロ九州(株)取締役 同社常務取締役 東京エレクトロ東北(株)常務取締役 当社常務取締役 当社取締役 東京エレクトロ九州(株)取締役会長 当社常勤監査役 (現在に至る)	9,952株

氏名 (生年月日)	略歴 (当社における地位及び担当、他の法人等の代表状況)		所有する 当社の株式数
<p>前田 博 (S29.5.10生)</p>	<p>昭和56年 4月 平成元年 8月 平成13年 6月 平成16年10月</p> <p>(当社における地位及び担当) 監査役</p>	<p>弁護士登録 三井安田法律事務所 所属 当社監査役 (現在に至る) 西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ 法律事務所) 所属 (現在に至る)</p>	<p>0株</p>

- 会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります

< 決議事項 >

- 1 . 取締役 1 4 名選任の件
- 2 . 監査役 2 名選任の件
- 3 . 第 4 5 期取締役賞与金支給の件
- 4 . 当社取締役に対し株式報酬として
新株予約権（ストックオプション）を発行する件
- 5 . 当社及び当社子会社の役員等に対し
株式報酬として新株予約権（ストックオプション）を
発行する件

< 役員報酬体系 >

取締役報酬

固定的報酬（月額報酬）

業績連動報酬
（年次賞与）

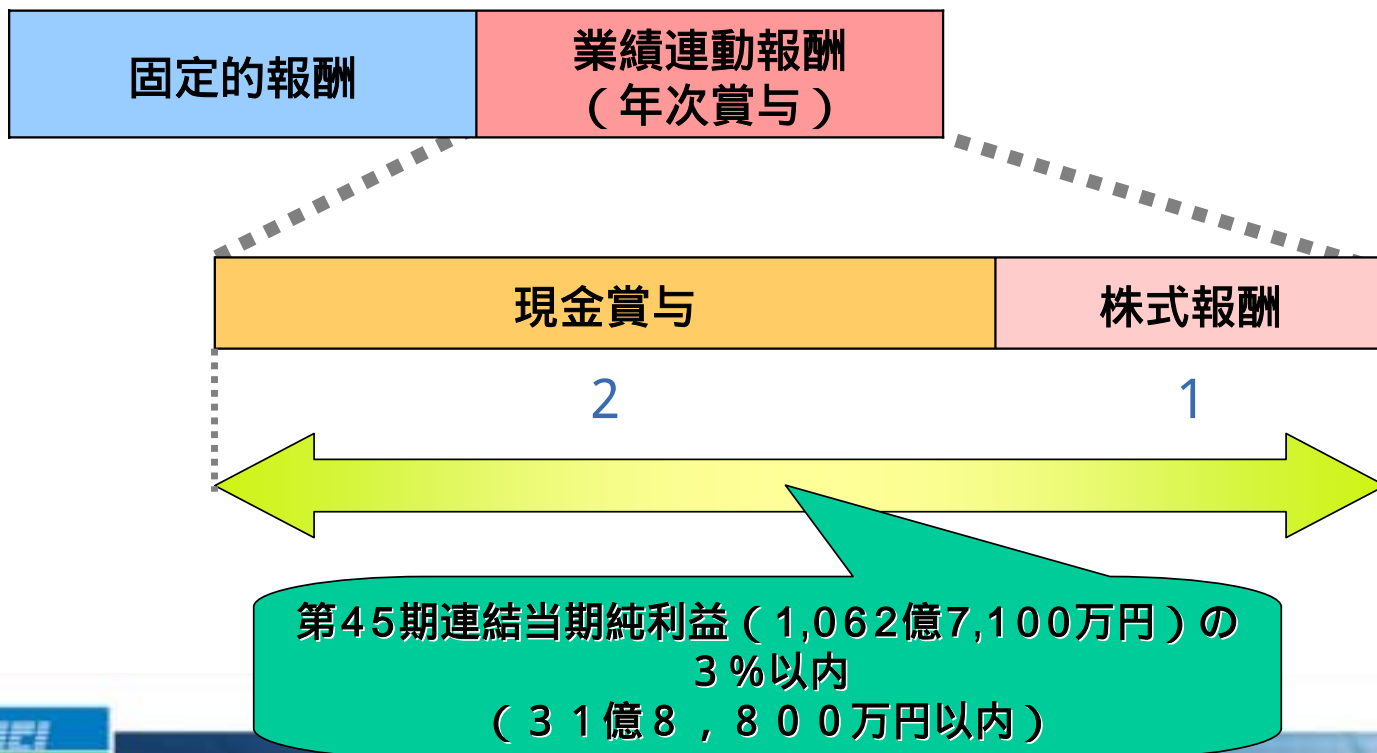
監査役報酬

固定的報酬（月額報酬）

役員退職慰労金 第43期以降、廃止しております

< 業績連動報酬（年次賞与） >

対象者 当社取締役、執行役員
 当社国内子会社（公開会社を除く）の取締役、執行役員
 当社海外子会社の会長、社長、副社長



< 業績連動報酬（年次賞与） >

第45期業績連動報酬と議案の関係

	現金賞与	株式報酬
業績連動報酬 総額枠	31億8,800万円 第45期連結当期純利益(1,062億7,100万円)の3%	
(配分)	2	対 1
報酬別総額枠	21億2,500万円	10億6,300万円
当社取締役	6億3,900万円 <第3号議案>	3億3,000万円 <第4号議案>
当社執行役員、 グループ会社の 取締役・執行役員	14億8,600万円 (代表取締役が配分を決定)	7億3,300万円 <第5号議案>

第3号議案

第45期取締役賞与金支給の件

第45期連結当期純利益(1,062億7,100万円)に対応する 業績連動報酬(年次賞与)の現金報酬分

	第45期取締役賞与金
対象者	第45期末時点在籍の取締役13名 (うち社外取締役2名)
報酬額	総額 6億3,900万円 (うち社外取締役分 1,400万円)

第4号議案

当社取締役に対し株式報酬として
新株予約権(ストックオプション)を
発行する件

株式報酬枠

第45期連結当期純利益(1,062億7,100万円)に対応する業績連動報酬(年次賞与)の株式報酬分

	取締役に対する株式報酬枠
対象者	<p>当社取締役(社外取締役を除く) 第1号議案が原案どおり承認可決された場合、対象者は11名となります</p>
報酬総額	<p>年額 3億3,000万円以内</p>

新株予約権の内容

株主以外の者に対し、特に有利な条件で新株予約権を発行する理由

第45期連結当期純利益(1,062億7,100万円)に対応する業績連動報酬(年次賞与)の株式報酬分。

割当対象者

当社取締役(社外取締役を除く)

新株予約権の内容

目的となる株式	当社普通株式 67,000株(上限)
新株予約権の総数	670個(上限) (新株予約権1個につき、100株)
発行の際の払込金額 (発行価額)	無償
行使価額	1株当たり、1円
権利行使期間	始期:新株予約権の割当日から3年を経過する日 終期:取締役会で決定(割当日から最長20年の範囲内)
行使条件	最低行使単位 = 新株予約権1個(100株) その他の権利行使の条件 新株予約権発行の取締役会決議、及び同決議に基づき締結される新株予約権割当契約による

発行規模については、目的となる当社普通株式1株当たりのオプション価値である4,880円(平成20年3月末時点でブラックショールズモデルにより試算)を用いて算出しております。

第5号議案

当社及び当社子会社の役員等に対し
株式報酬として
新株予約権(ストックオプション)を
発行する件

新株予約権の内容

株主以外の者に対し、特に有利な条件で新株予約権を発行する理由

1. 第45期連結当期純利益(1,062億7,100万円)に対応する業績連動報酬(年次賞与)の株式報酬分
2. 優秀な人材確保の競争力維持を目的とした株式報酬型ストックオプション

割当対象者

第45期期末時点の

1. 当社の執行役員(割当日時点の当社取締役を除く)
当社国内子会社の取締役・執行役員
当社海外子会社の会長・社長・副社長
2. 当社海外関係会社の役員(オフィサーを含む)・上級幹部従業員

新株予約権の内容

目的となる株式	当社普通株式 150,000株(上限)
新株予約権の総数	1,500個(上限) (新株予約権1個につき、100株)
発行の際の払込金額 (発行価額)	無償
行使価額	1株当たり、1円
権利行使期間	始期:新株予約権の割当日から3年を経過する日 終期:取締役会で決定(割当日から最長20年の範囲内)
行使条件	最低行使単位 = 新株予約権1個(100株) その他の権利行使の条件 新株予約権発行の取締役会決議、及び同決議に基づき 締結される新株予約権割当契約による



**私たちの技術が
世界を支え、未来を創ります。**

